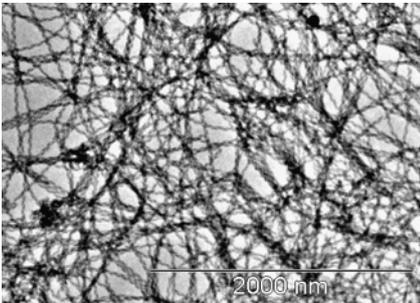
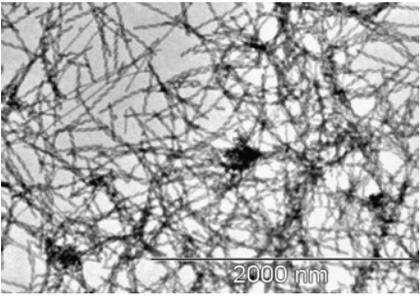
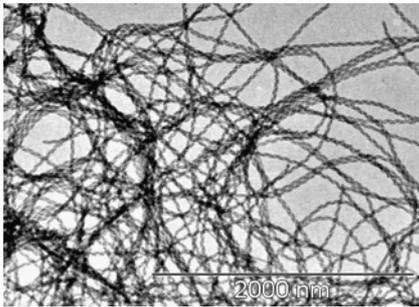
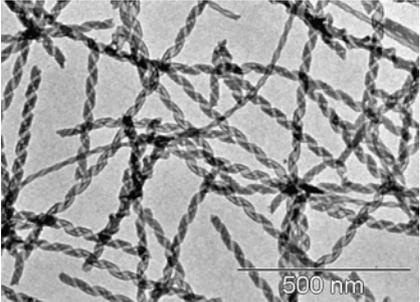
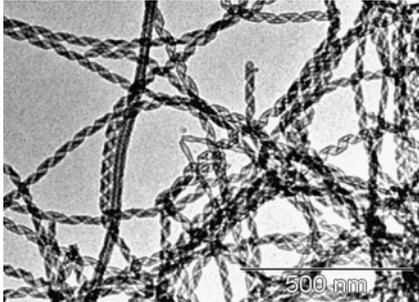


Q500 プロトコル シリカナノ構造体・凝集体の分散

プロトコル例および結果はユーザーからの情報に基づいています。



処理前	Q500 処理後	超音波洗浄機(他社) 処理後
		
		

プロトコル

サンプル種 :	シリカナノ構造体・凝集体の分散液
容量 :	3 mL
溶媒 :	エタノール
容器 :	ポリプロピレン遠沈管
チップ :	4418 (3.2mm(1/8")) マイクロチップ
Amplitude :	20%
パルス :	ON 1 秒、OFF 1 秒
Total On Time :	15 分
その他処理条件 :	氷上で処理

お客様の声

- シリカのらせん構造体の微細化・分散のため、Q500 を使用しています。
- 超音波洗浄機と比較して、直接超音波照射を行う Q500 の方が、早く、確実に微細化できます。

参考文献

1. Hennrich, F.; Krupke, R.; Arnold, K.; Rojas Stütz, J. A.; Lebedkin, S.; Koch, T.; Schimmel, T.; Kappes, M. M. The Mechanism of Cavitation-Induced Scission of Single-Walled Carbon Nanotubes. *J. Phys. Chem. B* **2007**, 111, 1932–1937.
2. Lucas, A.; Zakri, C.; Maugey, M.; Pasquali, M.; van der Schoot, P.; Poulin, P. Kinetics of Nanotube and Microfiber Scission under Sonication. *J. Phys. Chem. C* **2009**, 113, 20599–20605.
3. Warakulwit, C.; Majimel, J.; Delville, M.-H.; Garrigue, P.; Limtrakul, J.; Kuhn, A. Controlled Purification, Solubilisation and Cutting of Carbon Nanotubes Using Phosphomolybdic Acid. *J. Mater. Chem.* **2008**, 18, 4056–4061.
4. Yutaka, O.; Jiaji, C.; Dmytro, D.; Gregor, K.; Marie-Hélène, D.; Marie-Christine, D.; Hirota, I.; Makoto, T.; Emilie, P.; Reiko, O. Chiral Colloids: Homogeneous Suspension of Individualized SiO₂ Helical and Twisted Nanoribbons *ACS Nano* **2014**, 8, 6863–6872.

